PRODUCTION OF ALDOL COMPOUND

Publication number: JP6256248 (A)

Publication date: 1994-09-13

Inventor(s): KOBAYASHI OSAMU: KAWADA ATSUSHI +

Applicant(s): NIPPON STEEL CORP; NIPPON STEEL CHEMICAL CO +

Classifications - international:

B01J31/12; C07B61/00; C07C327/22; C07C45/51; C07C45/69; C07C49/723; C07C49/83; B01J31/12; C07B61/00; C07C327/00; C07C45/60; C07C49/00; (IPC1-7); B01J31/12; C07B61/00; C07C327/22; C07C45/69; C07C49/723; C07C49/72

C07C45/51B - European:

Application number: JP19930047931 19930309 Priority number(s): JP19930047931 19930309

Abstract of JP 6256248 (A)

PURPOSE:To obtain in a short time a compound useful as an intermediate for pesticides, medicines, etc., by reaction between a silyl enol ether and a carbonyl compound in the presence of a scandium catalyst. CONSTITUTION: The compound of formula R. 6 III (Z is H or SiR<4>R<5>R<6>) can be obtained by reaction between a compound of formula I (R<1> is H, alkyl, alkenyl, aryl or thio; R<2> and R<3> are aach H, halogan, nitro, cyano, alkyl, etc.; R<2>-R<3> are each H, alkoxy, aryl, etc.) and a compound of formula II (R<4> and R<6> are each H, alkyl, alkenyl, aryl, etc.) in the presence of a catalyst of formula Sc(OSO2Rf)3 (Rf is perfluoroalkyl or parfluoroalkoxy) pref. in a solvent (e.g. dichloromethane) at -100 to 150 deg.C for 10min to 50hr. The scandium catalyst has the following advantages; (1) indecomposable even if contacted with water and highly soluble in water; (2) easily separable from the products; (3) capabla of triggaring reaction even in a protogenic solvent; and (4) reusable.

Data supplied from the espacenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-256248 (43)公開日 平成6年(1994) 9月13日

(51)Int.Cl. ⁵ C 0 7 C B 0 1 J C 0 7 C	45/69 31/12		x ·	庁内整理番号 7188-4H 8017-4G 7188-4H 7188-4H 7106-4H 審査請求	F I		4の数 3	OL	(全	7	頁)	技術表示箇所 最終頁に続く
(21)出顯番号		特顯平5-47931			(71)	出願人	. 000006655 新日本製鐵株式会社					
(22)出願日		平成5年(1993)3月9日								_	21	目6番3号
					(71)	出願人	000006644					
		•				新日鐵化学株式会社 東京都中央区銀座5丁目13番				왕16목		
					(72)	発明者						
					(72)	(72)発明者 川田 敦志						
						神奈川県川崎市中原区井田1618番地、新日 本製鐵株式会社先端技術研究所内						
					(74)	人野为	弁理士	成額	勝步	e	(4)	1名)

(54) 【発明の名称 】 アルドール化合物の製造方法

(57)【要約】

【目的】 シリルエノールエーテルを用いた高茂沢的ア ルドール製造方法において、無溶鉱着しくは非プロトン 性溶媒中では不安定であるようなカルボニル化合物に対 しても適用可能であり、また、反応に使用した触媒を容 易に回収して再使用できる方法を提供する。

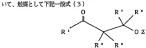
【構成】 触線としてスカンジウム原子とペルフルオロアルカンスルホン酸との塩であるスカンジウム触媒を使用し、シリルエノールエーテルとカルボニル化舎制とを反応させてアルドール化舎物を製造する。この際、水の地多フロントで観察とで振り着である。また、反応終了後、額触媒を小部液として報油性生成物から分離し、反応触媒として再使用することができる。は効果、広応なカルボニル化合物に対してシリルエノールエーテルを用いた高速折的アルドール輸合を適用することが可能になり、かつ、使用した触媒の回収と再使用が容易である。

【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式(1)

R 6 - S i - O R 3

(但し、式中、R! は水素原子、アルキル基、アルケニ ル基、アリール基以よう者を含め、また、R! 及びR は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアン基、ア ルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、 アシルオキシ基、オキシカルボニル基とはアミノカルボ エル基であり、R! とR! あるい起程? とR! とは一体 となって環状構造の一部を形成してもよい。そして、R

(但し、式中、R⁷ 及びR⁸ は水素原子、アルキル基、 アルケニル基又はアリール基であり、これらR⁷ とR⁸ とは一体となって環状構造の一部を形成してもよい)で 衰されるカルボニル化合物とを反応させて下記一般式 (4)で奏されるアルドール化合物を製造する方法にお



(但し、式中、Zは水素原子又は一SiR⁴ R⁵ R⁶ 基 である。そして、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、 R⁸、R⁷及びR⁸ は前記と同じである)で表されるア ルドール化合物の製造方法。

【請求項2】 反応をプロトン性溶媒共存下で行うこと を特徴とする請求項1記載のアルドール化合物の製造方 注

【請求項3】 反応終了後、触媒として使用したスカン ジウムト酸媒を水溶液として回収し、この回収した水溶液 から該触媒を単態し又は単離することなく、反応触媒と して再使用することを特徴とする請求項1又は2記載の アルドール化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、医薬、農薬等の合成中間体として有用なアルドール化合物の新規な製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】アルドール化合物の製造方法について は、二種類のカルボニル化合物を酸又は塩基の触媒下に 【化1】

(1)

 、R⁵ 、R⁶ は水素原子、アルキル基、アルコキシ基 又はアリール基であり、また、これらR¹ 、R⁵ 及びR 5 のいずれか2つとSiとが一体となって環状構造を形 成してもよい)で表されるシリルエノールエーテルと、 下記一般式(2)

(2)

Sc (OSO₂ Rf)₃ (3) (但し、式中、Rfはペルフルオロアルキル基又はペル フルオロアルコキシ基である)で表されるスカンジウム 触媒の存在下に反応させることを特徴とする下配一般式

(4) [化3]

[4:2]

(4)

反応させる、いわゆるアルドール総合が知られている (例えば、H. O. House "Modern Syn thetic Reactions" 2nd., W. A. Benjamin, California (197 2)参照)、

【0003】また、近年、このアルドール総合を高速択的に進行させる方法として、一方のカルボニル化合物を 由シリルエノールエーテルペ変換し、これと他者のカルボニル化合物をとかして、不動的用として各種の光学が活性が立め、 最され、その応用として各種の光学活性が立めませる方法が開 現され、その応用として各種の光学活性が立めませる方法が開 のでは、上のは、11973); b) T. Mukaiyama, K. Narasaka, K. Banno, Chem. Let t., p1011(1973); b) T. Mukaiy maa, K. Banno, K. Narasaka, J. Am. Chem. Soc., <u>96</u>, p7503(197 4); c) S. Kobayashi, H. Uchin o, Y. Fu Jishita, I. shiina, T. Mukaiyama, J. Am. Chem. Soc. 113, p4247(1991)]、このシリルエノー ルエーテルを経動する方法はかイス動映戦を用いるもの であるが、従来より知られているルイス酸は、水やアルコールのようなプロトン性溶媒が失すると、これと同じしてその機構能を失ってしまう。使って、反び法解媒等とくは非プロトン性溶媒中で行うことが必須となる。このため、ホルムアルブドドのように無溶媒素しくは非プロトン性溶媒中では不安定なカルボニル化合物に対しては、この方法の適用は困難であった。

[0004]また、この方法では、反応差で後、反応生 成物とルイス酸強無とを分離するために、通常、反応混 会物を水で処理している。力なわち、ルイス酸触差を火 と反応させ、水溶性物質に変えて分離している。しか 、この水溶性物質からルイス酸触薬を呼せすることは 非常に回離であり、また、疾薬する場合にも処理コスト が端み、工業的に大量に製造するための方法としては建 点があった。

【0005】この問題点を解決するルイス酸触媒として、Ln(OSO₂ CF₃)。(Ln:ランタノイド原子)で表されるランタノイド系触媒を本発明者は報告した(Chem.Lett., 2087-2090(1991)、しかし、この触媒を用いたアルドール化合物の製造方法では反応の際、長い反応時間を必要とする問題成分あった。



(但し、式中、R! は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルケニル基、アリール基又はチオ基であり、また、R! 及びR は水葉原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアン基、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アルカギン基、アシルオキシ基、オキシカルボニル基又はアミノカルボニル基であり、R! とR! あるいは記! とR! とは一体となって環状構造の一部を形成してもよい。そして、R

(但し、式中、R7 及びR8 は水素原子、アルキル基、 アルケニル基又はアリール基であり、これらR7 とR8 とは一体となって環状構造の一部を形成してもよい)で 表されるカルボニル化合物とを反応させて下記一般式 (4)で表されるアルドール化合物を製造する方法にお いて、他域として下記一般式

[0006]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明者は、 ランタノイド系帥様より高活性な帥様を用いたアルドー ル化合物の製造方法について鋭意研究を重ねた結果、あ る種のスカンジウム化合物が、シリルエノールエーテル とカルボニル化合物とを反応させてアルドール化合物を 製造する際のよい触媒になることを見出し、本発明に至 った。すなわち、本発明の目的は、ランタノイド系触媒 を用いた際よりも、短い反応時間でアルドール化合物を 製造し、使用した触媒を容易に回収して再使用すること ができるアルドール化合物の製造方法を提供することに ある。また、本発明の他の目的は、例えばホルムアルデ ヒドのように、無溶媒もしくは、非プロトン性溶媒中で 不安定なカルボニル化合物に対しても、適用することが でき、また、使用した触媒を容易に回収して再使用する ことができるアルドール化合物の製造方法を提供するこ とにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記一般式 (1)

[4:4]

(1)

5、R⁶ 人R⁶ は水素原子、アルキル基、アルコキシ基 又はアリール基であり、また、これらR⁴ 、R⁶ 及びR 6 のいずれか2つとSiとが一体となって環状構造を形 成してもよい)で表されるシリルエノールエーテルと、 下配一般式(2)

【化5】

(2)

Sc (OSO₂ Rf)₃ (3) (但し、式中、Rfはベルフルオロアルキル基又は、ベ

(4)

(但し、式中、Zは水素原子又は-SiR4 R5 R6 基 である。そして、R1 、R2 、R3 、R4 、R5 、 R6 、R7 及びR8 は前記と同じである)で表されるア ルドール化合物の製造方法である。

【0008】また、本発明は、シリルエノールエーテル (1) とカルボニル化合物(2) との反応をプロトン性 溶媒共存下で行うアルドール化合物の製造方法である。 更に、本発明は、前記のシリルエノールエーテル(1) とカルボニル化合物(2)とをスカンジウム触媒(3) の存在下に反応させてアルドール化合物(4)を製造す る方法において、反応終了後、スカンジウム触媒(3) を水溶液として回収し、この水溶液から該触媒を単離し 又は単離することなく、反応触媒として再使用するアル ドール化合物の製造方法である。

【0009】上記一般式(1)、(2)及び(4)にお いて、R1 、R2 、R3 、R4 、R5 、R6 、R7 及び R® として用いるアルキル基としては、置換又は非置換 のメチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基、イソブ チル基、tープチル基、オクチル基、ドデシル基等を広 節に例示することができる。また、R1 、R2 、R3、 R7 及びR8 として用いるアルケニル基としては、置換 又は非置換のエテニル基、プロペニル基、ブテニル基等 を例示することができる。更に、R1 、R2 、R3 、R R5 、R6 、R7 及びR8 として用いるアリール基 としては、置換又は非置換のフェニル基、トリル基、ナ フチル基、ピリジル基、チエニル基、フリル基、ピロリ ル基等が例示される.

【0010】 上記一般式(1) において、R1 として用 いるチオ基としては、メチルチオ基、エチルチオ基、セ ブチルチオ基の如きアルキルチオ基や、フェニルチオ



(但し、式中、R1 、R2 及びR3 は前記に同じ)で表 される α -ヒドロカルボニル化合物と、下記一般式 (6) (但し、式中、Xはハロゲン原子であり、R4 、R5 及

びR6 は前記に同じ)で表されるハロシランとから、公

XS1R4 R5 R6 (6)

知の方法によって容易に製造することができる〔例え tf. a) I. Fleming, I. Paterson. Synthesis, 1979, p736; b) H. O. House et al., J. Org. Che m.,34,p2324(1969)参照)。 【0014】また、一般式(3)で示されるスカンジウ ム触媒(3)も、酸化スカンジウム(Sc, O,)とペ ルフルオロアルカンスルホン酸(R, SO, H:式中、

基、トリルチオ基、ナフチルチオ基、ピリジルチオ基の ような芳香族チオ基等を挙げることができる。また、R 1 とR2 あるいはR2 とR3 とは、これらが一体となっ て環状構造の一部を形成してもよいが、この様な環状構 造としては、 置換又は非置換のシクロヘキセン環、シク ロベンテン環、シクロヘキサン環、シクロベンタン環、 シクロヘプテン環等を例示することができる。R4 、R 5 及びR6 として用いるアルコキシ基としては、メトキ シ基. エトキシ基. ブトキシ基等を具体例として挙げる ことができる。また、R1、R5 及びR6 のいずれか2 つとSiとが一体となって環状構造を形成してもよい が、具体例としては、シラシクロペンタン環、シラシク ロヘキサン環等のシラシクロアルカン環構造を挙げるこ とができる。

【0011】 上記一般式 (2) において、R7 とR8 と はこれらが一体となって環状構造の一部を形成してもよ いが、その環状構造の具体例としては、シクロヘキサン 環、シクロヘキセン環、シクロペンタン環、シクロペン テン環等のシクロアルカンあるいはシクロアルケン環を 挙げることができる。

【0012】 上記一般式(3) において、Rfの具体例 として、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル 基、ノナフルオロブチル基等のペルフルオロアルキル基 や、例えば、ナフィオン樹脂のように、ポリマーの側鎖 にペルフルオロアルコキシ基を成すものを維げることが できる。

【0013】 ト記一般式(1)で示されるシリルエノー ルエーテル (1) は、下記一般式 (5) [化7]

(5)

R_fは前記に同じ)とから、公知の方法により容易に製 造することができる〔米国特許第3,615,169号 明細書参昭了。

【0015】本発明の反応の実施に際しては、シリルエ ノールエーテル(1)とカルボニル化合物(2)とは、 通常、化学量論量、すなわち等モル量用いるが、一方を 過剰に用いても差し支えない。特に一方の化合物が安価 な場合、例えばカルボニル化合物(2)がホルムアルデ ヒドのような場合には、これを過剰に用いることにより 反応速度が速くなり、好ましいものである。

【0016】また、本発明の反応における前記スカンジ ウム触媒(3)の使用量は、シリルエノールエーテル (1) に対して0.1~200mo1%、好ましくは 0.5~100mol%、より好ましくは5~10mo 1%である。使用量が0.1 mo1%より少ないと反応 速度が遅くて実質的に反応が進行せず、また、好まざる 副反応の方が優先して原料のシリルエノールエーテル (1)が無駄に消費されることもある。一方、スカンジ ウム触媒(3)は、上記200mo1%を超えて大量に 使用しても差し支えないが、反応速度は実質的に改善さ れないため経済的な利点はない。

【0017】本発明の反応は、無溶媒でも行うことがで きるが、好ましくは溶媒中で行うのがよい。そして、使 用する溶媒としては、プロトン性溶媒及び非プロトン性 溶媒のいずれでもよい。非プロトン性溶媒としては、例 えば、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタ ン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等のハロゲン化 炭化水素や、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、 ジメトキシエタン、ジグライム等のエーテル系化合物 や、ヘキサン、シクロヘキサンのような脂肪族あるいは 脂環式炭化水素や、ベンゼン、トルエン、キシレン等の 芳香族炭化水素や、ジメチルホルムアミド、ジメチルア セトアミド、ジメチルイミダゾリジオン、ジメチルスル ホキシド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、アセトニト リル等のいわゆる非プロトン性極性溶媒等が広範に使用 できるが、原料や触媒に対する溶解度が高い点でエーテ ル系化合物や非プロトン性極性溶媒が好ましい。また、 プロトン性溶媒としては、水やメタノール、エタノー ル、イソプロビルアルコール等の低級アルコール類が好 ましい。これらのプロトン性溶媒は、前記カルボニル化 合物(2)としてホルムアルデヒドを用い、いわゆるヒ ドロキシメチル化を行う場合に有利である。特に水は、 この利点に加えてスカンジウム触媒(3)を溶かし易い ために反応が円滑に進行する点や、後述のように、スカ ンジウム触媒(3)の回収、再使用が容易になる点で、 本発明の溶媒として最適である。なお、水を溶媒として 用いる場合、好ましくはこれと容易に混合し得るエタノ ール、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアルデヒド 等との混合溶媒系として用いるのがよく、これによりシ リルエノールエーテル (1) に対する溶解性も向上す

[0018] 反応進度は、用いる反応需接や機械量によっても異なるが、適等。100~150℃の範囲であり、プロトン性溶媒中では0~150℃、好ましくは10~80℃の範囲である。また、反応時間も反応条件によって異なるが、反応は通常10分~50時間で終了する。

 ある化合物となる。また、反応溶媒がプロトン性溶媒で ある場合には、直接Zが水素である化合物が得られる。 【0020】反応終了後、反応混合物を種々の方法で後 処理することにより容易に目的とするアルドール化合物 (4)を単離することができるが、以下に示す方法は、 スカンジウム触媒(3)を容易に回収し、再使用するこ とができるという点で特に好ましい。すなわち、反応混 合物に溶媒量の水を加えたのちアルドール化合物(4) を溶媒抽出法等で水溶液から分離する。なお、反応溶媒 が水の場合には特に水を加えなくてもよい。この様にし て反応混合物からアルドール化合物(4)を分離した 後、このアルドール化合物(4)は常法に従い、必要な らば更に加水分解処理を施した後、カラムクロマトグラ フィー、蒸留、再結晶等の方法で精製される。一方、ス カンジウム触媒(3)は水溶液中に溶解しているので、 水を加熱留去することにより残留物として単離し、必要 ならば更に精製操作を施し、本発明の反応触媒として再 使用する。なお、本発明の反応を水溶媒中で実施する場 合には、該水溶液からスカンジウム触媒(3)を単離せ ずにそのまま次に行う本発明の反応において触媒として 再使用することができる。

[0021]

【作用】本発明で使用するスカンジウム触媒(3)は、いわゆるルイス酸触媒として機能していると考えられ、
あ、そして、不今特徴は、後来知られているルイス酸触媒の場合とは異なり、プロトン性溶媒中でも分解せずに 活性を保つ点と、水によく溶ける点にある。このため、
プロトン性溶媒中においても本発明の反応を野強に実施することができ、これによってプロトン性溶媒中でなければ盛台し易くて不安定をホルムアルデモドについてもカルボニル化合物(2)として使用することができ、た、良い結果が得られる。また、スカンジウム触媒

(3)は、水と接しても分解せずによく溶けるため、生 成物との分離が容易となり、本発明の反応がプロトン性 溶媒中でも実施可能な点と相まって、触媒再利用を簡便 に行うことができる。 【0022】

【実施例】以下、実施例に基づいて、本発明を詳細に説

【0023】実施例1

ジクロロメタン1.0 m l にトリス(トリフルオロメタ ンスルホン酸)スカンジウム0.02 m m o l を溶解させた後、一78℃で撹拌した。同温度でベンズアルデセド0.4 m m o l とをこの混合溶液にジカス・両温度で15時間撹拌した。次いで、減圧下にジカスタンで報出(5 m l x 3 回)した。得られた細性溶を水洗(10 m l x 3 回)し、乾燥(Na、 S O。)した後、減圧下に濾過し、残留物をカラムクロマトンデフィ (シリカゲル、ヘキサンー酢酸エチル)で精製し、反 応生成物であるアルドール化合物を収率81%で得た。 結果を表1に示す。

【0024】比較例1

ジクロロメタン1. 0mlにトリス(トリフルオロメタ ンスルホン酸) イットリウム 0.02mm o 1を溶解さ せた後、-78℃で攪拌した。同温度でベンズアルデヒ ドO. 4mmo 1と1-トリメチルシリルオキシー1-シクロヘキセン 0.44 mm o 1 とをこの混合溶液に加 え、同温度で15時間攪拌した。次いで、減圧下にジク ロロメタンを留去した後、水10mlを加え、ジクロロ メタンで抽出(5m1×3回)した。得られた抽出液を 水洗 (10m1×3回) し、乾燥 (Na, SO。) した 後、減圧下に濃縮し残留物をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル、ヘキサン-酢酸エチル)で精製し、反応 生成物であるアルドール化合物を収率2.3%で得た。 結果を表1に示す。

【0025】比較例2

ジクロロメタン1.0mlにトリス(トリフルオロメタ ンスルホン酸) イッテルビウム 0.02 mm o 1 を溶解 させた後、-78℃で撹拌した。間温度でベンズアルデ ヒドO. 4mmolと1-トリメチルシリルオキシー1 -シクロヘキセン 0.44 mm o 1をこの混合溶液に加 え、同温度で15時間攪拌した。次いで、減圧下にジク ロロメタンを留去した後、水10mlを加え、ジクロロ メタンで抽出(5m1×3回)した。得られた抽出液を 水洗 (10ml×3回) し、乾燥 (Na, SO,)した 後、減圧下に濃縮し残留物をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル、ヘキサンー酢酸エチル)で精製し、反応 牛成物であるアルドール化合物を収率1、5%で得た。 結果を表1に示す。

【0026】実施例2

ジクロロメタン1,0mlにトリス(トリフルオロメタ ンスルホン酸) スカンジウム 0.02mmolを溶解さ せた後、-78℃で撹拌した。同温度でベンズアルデヒ ド0.4mmolk1-hリメチルシリルオキシ-1-チオエチルー1-プロペン0.44mmolとをこの混 合溶液に加え、同温度で1時間撹拌した。次いで、減圧 下にジクロロメタンを留去した後、水10m1を加え、

ジクロロメタンで抽出 (5m1×3回) した。得られた 抽出液を水洗(10m1×3回)し、乾燥(Na。SO 。)した後、減圧下に濃縮し残留物をカラムクロマトグ ラフィー (シリカゲル、ヘキサン-酢酸エチル)で精製 反応生成物であるアルドール化合物を収率96%で 得た、結果を表1に示す。

[0027]実施例3

テトラヒドロフラン1,2mlと水0,3mlの混合溶 液にトリス (トリフルオロメタンスルホン酸) スカンジ ウムO. O3mmolを溶解させた後、室温で攪拌し た。この混合溶液に、ベンズアルデヒドO.3mmol と1-フェニル-1-トリメチルシリルオキシ-1-プ ロペン0.33mmolとを加え、同温度で12時間攪 拌した。次いで、減圧下にテトラヒドロフランを留去し た後、水10m1を加え、ジクロロメタンで抽出(5m 1×3回)した。得られた抽出液を水洗(10m1×3 回) し、乾燥 (Na, SO₄) した後、減圧下に濃縮し 残留物をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル、ヘキ サンー酢酸エチル)で精製し、反応生成物であるアルド ール化合物を収率83%で得た。結果を表1に示す。

【0028】実施例4

実施例3の反応において、反応混合物をジクロロメタン で抽出した後の水溶液10mlを減圧濃縮した後、さら に、200℃で8時間乾燥した。得られた白色結晶を、 テトラヒドロフラン1,2mlと水0,3mlの混合溶 液に溶解させた後、室温で撹拌した。この混合溶液に、 ベンズアルデヒドロ、3mmolと1-フェニル-1-トリメチルシリルオキシ-1-プロペン0.33mmo 1とを加え、同温度で20時間撹拌した。次いで、減圧 下にテトラヒドロフランを留去した後、水10mlを加 ジクロロメタンで抽出(5m1×3回)した。得ら れた抽出液を水洗 (10ml×3回) し、乾燥 (Na, SOa)した後、減圧下に濃縮し残留物をカラムクロマ トグラフィー (シリカゲル、ヘキサン一酢酸エチル)で 精製し、反応生成物であるアルドール化合物を収率86 %で得た。結果を表1に示す。

[0029]

【表1】

	反応生成物	収率 (%)
実施例 1	Ph OH O	8 1
実施例 2	Ph SEt	9 6
実施例 3	Ph Ph	8 3
実施例 4	Ph Ph	8 6
比較例 1	Ph OH O	2. 3
比較例 2	Ph OH O	1. 5

[0030] 【発明の効果】本発明の方法は、広範なカルボニル化合

ルイス酸触媒によるアルドール縮合反応の反応時間の短 時間化を可能とするものである。このことは、工業的か 物について、近年開発された容易に回収再使用が行える つ実用的価値は大きい。

フロントページの続き				
(51) Int. Cl. 5 // C O 7 B 61/00	識別記号 300	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所